

Toppan Photomask and EVG collaborate to accelerate the application of nanoimprint lithography | PR Newswire – September 19, 2022

Toppan Photomask与EVG达成合作，加快推进纳米压印光刻技术应用 | 美通社

2022-09-20 16:42

分享到：



Toppan Photomask制造的半导体用光掩模，纳米压印光刻(NIL)母版采用同样的材料、技术和工艺制造而成。

光掩模供应商Toppan Photomask Co. Ltd.与为MEMS、纳米技术和半导体市场提供晶圆键合及光刻设备的供应商EV Group (EVG) 宣布，两家公司已达成协议，共同推广赋能光电产业的大批量制造(HVM)工艺—纳米压印光刻技术(NIL)。

此次合作旨在确立NIL为光电制造的行业标准生产工艺，并加速其在HVM中实施，以支持各种应用。这些应用包括增强/混合/虚拟现实耳机、智能手机、汽车传感器和医疗成像系统。（美通社,2022年9月20日奥地利圣弗洛里安和东京）

阅读全文: [Toppan Photomask与EV Group达成合作](#)

<https://www.prnasia.com/lightnews/lightnews-1-102-45832.shtml>